



CAS IR Grid / 大连化学物理研究所 / 中国科学院大连化学物理研究所

一种中孔结构氧化铝的制备方法

文献类型：专利

作者 李淑莲；陈光文；焦凤军；欧阳喜莲

发表日期 2010-02-10

专利国别 中国

专利号 CN200810012732.7

专利类型 发明

关键词 物理化学

权利人 中国科学院大连化学物理研究所

是否PCT专利 是

中文摘要 本发明为一种中孔结构氧化铝的制备方法，前驱体是AlOOH和 Al(OH)3，按比例在酸性介质中混合后，经特殊预处理得到的Al2O3，平均孔径3-5nm，孔体积0.25-0.35ml/g，BET比表面积250-310m²/g，特别适合乙醇催化脱水制乙烯的反应过程。

学科主题 物理化学

公开日期 2010-02-10 ; 2011-07-11

申请日期 2008-08-08

语种 中文

资助信息 大连化物所

专利证书号 带填写

专利申请号 CN200810012732.7

专利代理 马驰；周秀梅

源URL [http://159.226.238.44/handle/321008/107363]

专题 大连化学物理研究所_中国科学院大连化学物理研究所

推荐引用方式 李淑莲,陈光文,焦凤军,等. 一种中孔结构氧化铝的制备方法, 一种中孔结构氧化铝的制备方法. CN200810012732.7.

GB/T 7714 2010-02-10.

入库方式：OAI收割

来源：大连化学物理研究所

浏览

0

下载

0

收藏

0

其他版本

除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。